Journal of Engineering of Heilongjiang University

DOI: 10.13524/j.2095-008x 2014.01.009

N、C 掺杂比例对锐钛矿 TiO₂ 电子结构 影响的第一性原理研究

李宗宝^{1a},贾礼超²,王 霞^{1b},王梁杰^{1a}

(1. 铜仁学院 a. 物理与电子科学系; b. 生物科学与化学系,贵州 铜仁 554300; 2. 华中科技大学 材料科学与工程学院, 材料加工与模具重点实验室,武汉 430074)

摘 要:采用基于密度泛函理论方法,分别计算了 N、C 原子不同比例掺杂锐钛矿 TiO₂ 的形成能、晶体结构 和电子结构等性质。计算结果表明:原子替位掺杂后体系晶格发生畸变;C 原子替位掺杂更倾向于替代 Ti 位, N 倾向于替代 O 位;两种替位掺杂均使 TiO₂ 光吸收带发生明显红移;N 掺杂比例为 2.08%和 3.13%、C 掺杂 比例为 2.08%时,对 TiO₂ 的改性最佳。

关键词:锐钛矿 TiO₂;第一性原理;N 掺杂;C 掺杂;形成能 中图分类号:O647 文献标志码:A 文章编号:2095-008X(2014)01-0041-06

Density function theory on the electronic structure property of anatase TiO₂ doped by N or C with different percents

LI Zong-Bao^{1a}, JIA Li-Chao², WANG Xia^{1b}, WANG Liang-Jie^{1a}

(1. Tongren University, a. Department of Physics & Electronic Science; b. Department of Biology & Chemistry, Guizhou 554300, China; 2. School of Materials Science and Engineering, State Key Lab of Material Processing and Die & Mould Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: Formation energy, crystal structure and electronic structure of C, N doped anatase TiO_2 are calculated based on the density functional theory of plane-wave ultrasoft pseudoptential. Results indicate that, due to doping of the C or N atoms in anatase TiO_2 , the lattice distorts obviously. The substitution of C tends to Ti site while N tends to O site. All the substitutions lead to the red shift of the optical absorption and increasing coefficient of light absorption. When N concentrations are 2 08% and 3 13% in N-doped TiO_2 , the highest photocatalytic activity is obtained, while it is 2 08% for C-doped one. Key words: anatase TiO_2 ; DFT; N-doped; C-doped; formation energy

0 引 言

催化氧化还原及环境有机污染物降解等方面得到广 泛应用,已成为最具应用潜力的光催化剂^[1-4]。但 基于较大的禁带宽度($3 \sim 3.2 \text{ eV}$),纯净 TiO₂ 只 对紫外光($\lambda < 400 \text{ nm}$)有响应,而对占太阳光能

TiO₂因在太阳光的转换和储存、温室气体光

收稿日期: 2013-11-27

基金项目:贵州省自然科学基金项目([2012]17);贵州省教育厅重点项目([2013]182);铜仁学院科研基金项目(S1232) 作者简介:李宗宝(1982-),男,山东胶南人,副教授,硕士,研究方向:功能材料改性研究,E-mail:zongbaoli1982@163.com。 43%的可见光没有响应,因此如何改进 TiO₂,并 使其光响应范围从紫外光区扩展到可见光区成为目 前研究的重点。当前对 TiO2 进行改性采用方法主 要由非金属离子掺杂^[5]、半导体复合^[6]、金属沉 积[2]等。然而实验发现:通过过渡金属离子体掺杂 可以依托 d 电子的迁移来提高 TiO₂ 的光催化活 性^[8],但过渡金属掺杂会促使载流子发生复合并降 低 TiO₂ 热稳定性。大量实验也证明贵金属原子的 表面沉积,如 $Ag/TiO_2^{[9]}$, $Pt/TiO_2^{[10]}$, Sn/ TiO₂^[11]等,对TiO₂光催化活性的提高具有显著的 作用。但贵金属的大量使用必然增加制造成本,不 利于工业化生产的推广。自 Sato 等^[12]报道了 N 掺 杂的 TiO₂ 具有更好的光催化活性,并提出非金属 掺杂能有效降低 TiO₂ 的禁带宽度并调节能带分布 以来,非金属如 $C^{[13]}$ 、 $N^{[14]}$ 、 $S^{[15]}$ 、 B 等掺杂的 TiO₂ 的报道日益增多。

Sato 等^[12] 通过 NO_x 掺 N 制备了 TiO_{2-x}N_x 可 见光响应催化剂,但存在制备效率低、成本高等缺 点。Cui^[16]等通过在空气中焙烧 TiN 得到 N 掺杂 的 TiO₂,并发现其在可见光下可以有效催化分解 水制取 H_2 。刘守新等^[17]制备的 N 掺杂 TiO₂ 在可 见光下具有较好的光响应效率。对于 C 掺杂, Khan 等^[18]发现 C 掺杂 TiO₂ 薄膜在可见光 440 nm 和 535 nm 处有两条吸收带边; Sakthivel 和 Kisch 等^[19]报道了其制备的 C/TiO₂ 的光催化效率比未掺 杂高出 5 倍。Chen 等^[20] 通过高温氧化法制备 C、 N和S单掺杂锐钛矿 TiO_2 粉末,发现N掺杂的可 见光催化效果最明显, 而 C 的杂质能级则较深。 由于材料制备过程中掺杂粒子的替位方式受生长环 境的影响较大,因此不同化学环境下 C、N 掺杂 TiO₂体系的结果会有较大差异。然而,至今为止 掺杂方式,缺陷存在形式以及掺杂比例的变化对光 催化性能的影响尚未有系统的研究报道。

本文从第一性原理出发,采用超原胞模型计算 了 C、N 不同比例掺杂 TiO2 的形成能、晶体结构 以及电子结构的变化。从理论上分析了 C、N 原子 替位掺杂的位置,不同比例掺杂对 TiO2 电子结构 和光学性质等的影响,并揭示了单掺杂对 TiO₂ 性 能的影响。

计算方法 1

基于密度泛函理论的平面波超软赝势方法,采

用 GGA+PBE 交换关联方法^[21]对 TiO₂2×2×2 的 超原胞结构进行优化,获得最佳结构参数。在倒格 子空间^[22]选取平面波截断能: $E_{cut} = 400 \text{ eV}$, K 点 取为 $4 \times 4 \times 4$,自洽场运算精度设为单原子能量收 敛至 2. $0 \times 10^{-6} eV$ 。由于传统 GGA 理论在能带计 算时会低估能带,为与实验形成对比,本文采用 GGA+U^[23]方法对计算的能带结构和态密度进行 修正使其与实验结果相吻合。计算中所选修正参数 为: U=6.3 eV和 $J=1 \text{ eV}^{[24]}$ 。后文所有掺杂所选 参数均采用相同的设置,以保证计算结果的可比 性。为构建多浓度掺杂,在锐钛矿型 TiO₂ 在 $2 \times 2 \times 2$ 优化的超原胞结构基础上,并用 N 或 C 随 机取代晶格中 $1 \sim 4$ 个 O 或 Ti 原子,得到与实验 方案相近的掺杂比例。因为极高的形成能及不稳定 性,N和C的填隙缺陷模型在本文中不做讨论。 另外,由于 N 与 O 原子在元素周期表中位置的相 近性,已经证明 N 只能取代 O 原子掺杂;但对于 C 替位,由于其在周期表中位置的特殊性,其掺杂 方式尚未明确,为获取其真实替位方式,本文对 C 的替位方式分别采用了取代 Ti 位和 O 位的不同方 式进行,并在此基础上进行结构优化。本文所有计 算均在 VASP 软件包中进行^[25-26]。

2 结果与讨论

为有效讨论 C、N 不同比例掺杂对 TiO_2 的影 响,首先计算了 C、N 不同位置掺杂后形成能的大 小。根据C在元素周期表中的特殊位置,本文认 为 C 在 TiO_2 晶体可能出现 C^{2-} 和 C^{4+} 两种离子类 型。基于不同掺杂后体系的稳定性条件,为了进一 步明确元素掺杂后在 TiO₂ 中真实的占据位置, 计 算了不同掺杂体系杂质的形成能 E_{form} :

$$E_{\text{form}} = E_{\text{doped}} - E_{\text{pure}} - m \cdot \mu_{\text{C}} - n \cdot \mu_{\text{N}} + u \cdot \mu_{\text{O}} + v \cdot \mu_{\text{T}}$$
(1)

$$\mu_{\rm N} + u \bullet \mu_{\rm O} + v \bullet \mu_{\rm Ti} \tag{1}$$

式中 E_{pure} 和 E_{doped} 分别是掺杂前、后锐钛矿 TiO_2 的能量; μ_N 、 μ_C 、 μ_0 和 μ_{Ti} 分别代表 N、C、O、Ti 4 种元素的化学势; $m_xn_xu_xv$ 对应体系掺杂后掺入原 子数目和被替位的原子数目。采用上述公式计算 C $\mathbf{n} \mathbf{N}$ 分别取代一个 Ti 或者 O 后所得形成能见表 1。

由表 1 可见, N@O 的形成能比 N@Ti 低, C @Ti的形成能比 C@O 低。表明, N 原子倾向于 替位 O 位而 C 则倾向于 Ti 位。该结果与张晓艳 等^[27]的实验推测不同。

	表 1 各掺杂体系的杂质形成能
Table 1	Formation energies E_{form} of different doped TiO ₂

	N@O	N@Ti	C@O	C@Ti
$E_{ m form} \ / { m eV}$	4.37	7.51	6.51	5.27

表 2 列出了结构优化后 3 种体系的结构参数。 由表 2 可见,优化后的 $2 \times 2 \times 1$ 纯 TiO₂ 超晶胞的 晶格参数为 a=b=7577 Å, c=9541 Å,与实验 结果吻合较好^[4]。掺杂后,由于杂质元素离子半径 不同,掺杂后导致晶体结构对称性下降,晶格发生 畸变。因为 N³⁻离子半径比 O²⁻半径大,N 掺杂后 Ti-N 键长比未掺杂的 Ti-O 键长。C⁴⁺离子半径为 0 16 Å,远远小于 Ti⁴⁺离子的半径 0 68 Å,因此 C 取代 Ti 所形成的 C-O 键较 Ti-O 键 (1961 Å) 要小得多,仅为 1 242 Å。由于杂质离子的掺杂, 引起的晶格畸变同样会导致内部偶极矩的产生。偶 极矩的变化对 TiO₂ 的光催化性能有促进作用。

表 2 结构优化后各掺杂 TiO₂ 体系的 晶格参数和平均键长(Å)

Table 2Lattice parameters and average bond lengths of the
doped TiO2 after geometry optimization (in Å)

	а	b	с	Ti-O	Ti-N	С-О
Pure	7.577	7.577	9.541	1.976		
N@O	7.603	7.570	9.508	1. 980	2.008	
C@Ti	7.786	7.786	9. 389	1.961		1. 242

2.1 不同浓度 N 掺杂 TiO₂ 的电子结构

基于替位结果,研究了 N@O 体系掺杂量与材 料性能的变化趋势。基于该模型计算了各比例条件 下 TiO_2 的能带结构和态密度,见图1和图2。晶 格中 N 原子取代部分 O 原子后,在晶格内部形成 了 O-Ti-N 键, 且由于 N 与 O 原子半径的差异而 引起晶体结构发生畸变,导致掺杂后的禁带宽度 (*Eg*) 以及杂质能级与导带底之间的带宽 (Im-CBM) 发生变化,具体数值详见表 3。由图 1 和表 2 可见, N 掺杂对禁带宽度大小的影响较小,均在 4 种掺杂结构的价带顶产生了新的杂质能级。在忽 略杂质能级条件下,禁带宽度在掺杂浓度为 2.08%时最小(为2.97 eV)。若考虑杂质能级对 跃迁的辅助作用,杂质能级叠加后使 TiO_2 的吸收 带边移动到可见光区。且随着掺杂浓度的增大,杂 质能级的密度增加,从而增加了电子的跃迁几率。 通过对比图1和图2费米面附近杂质能级的密度, 由图 2 可见,掺杂比例为 3.13%时,离子跃迁的





几率最大,为较佳掺杂比例。当掺杂浓度继续增加 时(>4.17%),杂质能级将交叠于价带顶部,并 使整个价带顶发生上移。该结果在一定条件下有利 于光生载流子的传输,但若 N 含量过高则容易形 成 TiN 结构并使掺杂后的体系呈现金属性,在可 见光区域不透明。并且随着 N 含量的增长,其还 将导致晶格中大量缺陷的产生,成为电子-空穴对 的复合中心,从而降低材料的光催化活性。因此, N 掺杂只有在恰当浓度范围内有利于提高 TiO₂ 的 光催化性能。



图 2 N不同浓度掺杂 TiO₂ 的态密度 Fig 2 Total DOS of N-doped configurations with different ratios

表 3 N不同浓度掺杂后的禁带宽度 (eV) Table 3 Band gaps of N-doped configurations with different ratio (in eV)

Ratio	1. 04%	2.08%	3. 13 %	4. 17%
Eg	2.99	2.97	3.00	2, 98
Im-CBM	2,56	2, 53	2,58	2,60

为进一步了解 N 掺杂对 TiO₂ 能级的影响,给 出了不同掺杂浓度的分波态密度,见图 3。费米能 级附近的杂质能级主要由 N-2p 态组成且弛豫于价 带顶,而 O-2p 和 Ti-3d 态的贡献则较小。通过上 述比较可见,N 掺杂后,体系的价带顶位置主要由 N-2p 态决定,O-2p 态则与 N-2p 发生交叠使能带 密度增加。而掺杂和未掺杂 TiO₂ 的导带底均由 Ti-3d 态决定,并未发生明显变化。掺杂浓度为 2.08%和 3.13%时,由于 N-2p 与 Ti-3d 态之间的 p-d 杂化作用,导带中 Ti-3d 态相对有微小的下移。

通过上述分析可见:在较低浓度掺杂时,掺杂浓度的变化对 TiO_2 电子结构的影响并不明显,N 的最佳含量为 2. 08 %和 3. 13 %时对 TiO_2 光催化性能的提升最为有利。





2.2 不同浓度 C 掺杂 TiO₂ 的电子结构

基于单掺杂体系中 C 原子更倾向于取代 Ti 原 子并以 C⁴⁺的阳离子形式存在,因此在构建 C 掺杂 TiO₂ 晶体模型时,所有计算仅考虑 C 原子替位取 代 Ti 原子的情况,忽略其取代 O 原子情况。图 4 给出了不同浓度 C 掺杂 TiO₂ 的能带结构。由图 4 可见,由于 C 的非金属性,虽取代 Ti 但未在禁带 中引入杂质能级,而是直接导致导带向低能级移动 并降低禁带宽度,增加电子的跃迁几率。比较不同 浓度掺杂的禁带宽度可见:当掺杂量为 3.13%和 4.17%时禁带宽度相同,均为 2.51 eV;掺杂浓度 为 1.04%时禁带宽度最大,为 2.60 eV;当掺杂浓 度为 2.08%时,禁带宽度最小,为 2.30 eV。证明 掺杂后 TiO₂ 均发生明显红移,且 C 掺杂浓度为 2.08%时现象尤为明显。

为进一步揭示 C 对 TiO₂ 掺杂的浓度效应,还 计算了不同浓度掺杂体系的分波态密度,见图 5。 由图 5 可见,C 掺杂后 TiO₂ 的价带主要由 O-2p 态 和 T-3d 态组成,且主要占据低能区域。O-2p 态主 要贡献费米面附近能级,决定了价带顶的位置;导 带主要由 Ti-3d 态和 C-2p 态组成,且强烈的 pd 轨 道杂化使导带发生明显下移,从而减小禁带宽度。



图 4 不同浓度 C 掺杂 TiO₂ 体系的能带结构 Fig. 4 Band structure for C-doped configurations with various doping levels

当掺杂浓度为 2.08%和 4.17%时,Ti-3d 态和C-2p 态之间的 pd 杂化现象非常明显,出现了较强的杂 化尖峰。通过对不同体系中 O-2p 态的态密度对 比,可见当掺杂浓度为 4.17%时,O-2p 态在费米 能级附近的杂质峰明显强于其它 3 种掺杂情况,从 而证明在可见光条件下,价电子向导带跃迁的几率 增加,有利于 TiO₂ 的光催化效率的提高。





通过上述分析可见 C 随掺杂浓度变化时, C-2p态与 Ti-3d 态之间的杂化效应直接导致导带向 低能方向移动,从而引起了禁带宽度的减小并使其 吸收带边产生明显红移。根据对禁带宽度的对比可 见:当掺杂浓度为 2 08%时,对可见光的响应最 强,此时催化活性应为最高。通过与 N 掺杂 TiO₂ 结果比较可见:浓度效应对 C 掺杂体系光催化性 能的影响更为明显。

3 结 论

基于密度泛函理论的第一性原理,计算了 N、 C 原子不同比例掺杂锐钛矿 TiO₂ 的形成能、晶格 结构及电子结构。通过对形成能的比较可见 N 原 子倾向于替代 O 位而 C 则取代 Ti 位;通过对不同 比例掺杂晶体的能带和带密度的分析可见 N 在较 低浓度掺杂时,掺杂浓度对 TiO₂ 电子结构的影响 并不明显,且 N 含量为 2 08%和 3.13%时 TiO₂ 对可见光的响应最佳,此时光催化性能较好;C 掺 杂浓度为 2 08%时,其对可见光的响应最佳。与 N 掺杂 TiO₂ 相比,浓度效应对 C 替位 Ti 位掺杂

体系光催化性能的影响更为明显。

参考文献

- [1] Fujishima A, Honda K. Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode [J]. Nature, 1972, 238: 37-39.
- [2] Gole J L, Stout J D, Burda C, et al. Highly efficient formation of visible light tunable TiO_{2-x} N_x photocatalysts and their transformation at the nanoscale [J]. The Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108: 1 230-1 240.
- [3] Sinsebigler A L, Lu G, Yates J T. Photocatalysis on TiO₂ surface: principles, mechanism and selected results [J]. Chemical Reviews, 1995, 95: 735-758.
- [4] Fujishima A, Rao T N, Tryk D A. Titanium dioxide photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology C [J]. Photochemistry Reviews, 2000, 1: 1-21.
- [5] Asahi R, Morikawa T, Ohwaki T. Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides [J]. Science, 2001, 293: 269-271.
- [6] 程 刚,周孝德,李 艳,等. 纳米 ZnO-TiO₂ 复合半
 导体的 La³⁺ 改性及其光催化活性 [J]. 催化学报, 2007,28 (10): 885-889.
- [7] 李宗宝,王 霞,贾礼超. N/Fe 共掺杂锐钛矿 TiO₂
 (101) 面的协同作用的第一性原理研究 [J]. 物理学报, 2013, 20: 1-5.
- [8] Hou Q Y, Zhang Z D, Li C. First-principles study of the electronic life and red shift effect of Sm-doped anatase TiO₂ [J]. Journal of Functional Materials, 2012, 43 (19): 2 599-2 604.
- [9] Subrahmanyam A, Biju K P, Rajesh P, et al. Surface modification of solgel TiO₂ surface with sputtered metallic silver for Sun light photocatalytic activity: Initial studies [J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2012, 101: 241-248.
- [10] Li Z B, Wang X. First-principle study of electronic structure and enhanced visible-light photocatalytic activity of anatase TiO₂ through C and F codoping [J]. Advanced Materials Research, 2013, 746: 400-405.
- [11] Zhang M Y, He G Z, Ding C C, et al. Mechanism of arsenate (V) adsorption on TiO₂ surfaces [J]. Acta Phys. Chim. Sin, 2009, 25, 2 034-2 038.
- [12] 郑树凯,吴国浩,刘 磊. P 掺杂锐钛矿相 TiO₂ 的 第一性原理计算 [J]. 物理学报, 2013 (4): 94-100.
- [13] Carp O, Huisman C L, Reller A. Photoinduced reactivity of titanium dioxide [J]. Progress in Solid State Chemistry, 2004, 32 (1-2): 33-177.
- [14] Suda Y, Kawasaki H, Ueda T, et al. Preparation of

high quality nitrogen doped TiO₂ thin film as a photocatalyst using a pulsed laser deposition method [J]. Thin Solid Films, 2004, 453: 162-166.

- [15] Umebayashi T, Yamaki T, Itoh H, et al. Band gap narrowing of titanium dioxide by sulfur doping [J]. Applied Physics Letters, 2002, 81: 454-456.
- [16] Cui X L, Ma M, Zhang W, et al. Nitrogen-doped TiO₂ from TiN and its visible light photoelectrochemical properties [J]. Electrochem Commun., 2008, 10: 367-371.
- [17] 刘守新,陈孝云,李晓辉.N 掺杂对 TiO₂ 形态结构 及光催化活性的影响 [J]. 无机化学学报,2008, 24:253-259.
- [18] Khan S U M, Al-Shahry M, Ingler Jr W B. Efficient potochemical water splitting by a chemically modified n-TiO₂ [J]. Science, 2002, 297: 2 243-2 245.
- [19] Sakthivel S, Kisch H. Daylight photocatalysis by carbon-modified titanium dioxide [J]. Angew Chem-Int Edit, 2003, 42 (40): 4 908-4 911.
- [20] Chen V, Burda C. The electronic origion of the visible-light absorption properties of C-, N- and S-doped TiO₂ nanomaterials [J]. J. Am. Chem. Soc, 2008, 130: 5 018-5 019.
- [21] Monkhorst H J, Pack J D. On special points for brillouin zone integrations [J]. Phys. Rev. B., 1976, 13: 5 188-5 192.
- [22] Dudarev S L, Botton G A, Savarsov S Y. Electron-energy-loss spectra and the structural stability of nickel oxide: An LSDA + U study [J]. Phys. Rev. B., 1998, 57: 1 505-1 509.
- [23] Kavan L, Gratzel M, Gilbert S E. Electrochemical and photoelectrochemical investigation of single-crystal anatase [J]. J. Am. Chem. Soc., 1996, 118: 6 716-6 723.
- [24] Jia L C, Wu C C, Li Y Y, et al. Enhanced visiblelight photocatalytic activity of anatase TiO₂ through N and S codoping [J]. Appl. Phys. Lett., 2011, 98: 211 903-211 905.
- [25] Kresse G, Furthermuller J. Efficiency of ab-initio total energy calculations using a plane-wave basis set [J]. Phys. Rev. B., 1996, 54: 11 169-11 186.
- [26] Perdew J P, Burke K. Generalized gradient approximation made simple [J]. Phys. Rev. Lett., 1996, 77: 3 865-3 868.
- [27] 张晓艳,崔晓莉. C-N 共掺杂纳米 TiO₂ 的制备及其光 催化制氢活性 [J]. 物理化学学报,2009,25 (9): 1 829-1 834.